

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 1 月 5 日 (2006.1.5)

【公表番号】特表 2001-510779(P2001-510779A)

【公表日】平成 13 年 8 月 7 日 (2001.8.7)

【出願番号】特願 2000-503812(P2000-503812)

【国際特許分類】

A 6 1 K 8/00 (2006.01)

A 6 1 Q 5/00 (2006.01)

A 6 1 K 8/72 (2006.01)

C 0 8 G 77/46 (2006.01)

C 0 8 L 83/12 (2006.01)

【F I】

A 6 1 K 7/06

A 6 1 K 7/00 J

C 0 8 G 77/46

C 0 8 L 83/12

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 7 月 20 日 (2005.7.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

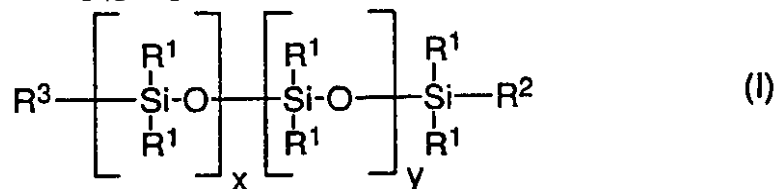
(a) エチレン系不飽和モノマーを

(b) ポリアルキレンオキサイド含有シリコン誘導体の存在下に

ラジカル重合させる方法で得られた、水溶性又は水分散性であるか又は、それが中性化可能な基を有するモノマーからなっている場合には中性化された形で水溶性又は水分散性であるポリマーの化粧品処方物のための使用において、

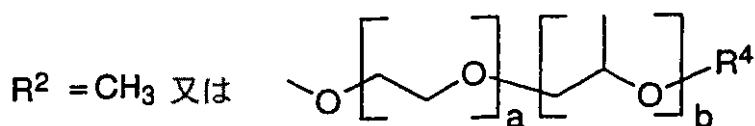
ポリアルキレンオキサイド含有シリコン誘導体 (b) として、式 I :

【化 1】



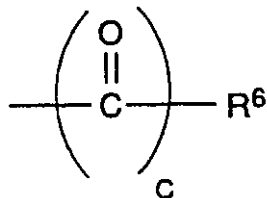
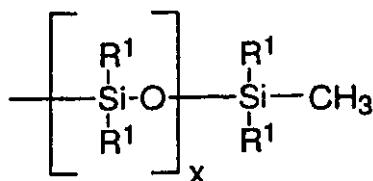
[ 式中、

【化 2】



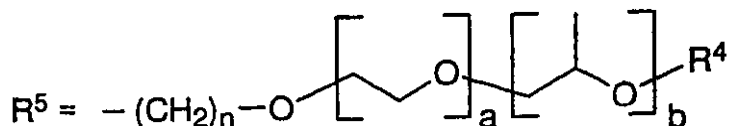
$R^3 = \text{CH}_3 \text{ 又は } R^2$

$R^4 = \text{H, CH}_3,$



であり、 $R^6$  は、炭素原子 1 ~ 40 を有し、アミノ基、カルボン酸基又はスルホネート基を有してよい有機基を表すか、又は  $c = 0$  の場合には無機酸のアニオンをも表し、この際に、基  $R^1$  は同じ又は異なるものであってよく、メチル、エチル、プロピル、ブチル、イソブチル、ペンチル、イソペンチル、ヘキシル、オクチル、デシル、ドデシルおよびオクタデシル、シクロヘキシル、芳香族基、特にフェニルまたはナフチル、混合芳香 - 脂肪族基、たとえばベンジルまたはフェニルエチル、さらにはトリルおよびキシリルおよび  $R^5$  から成る群から選択されたものであり、この際、

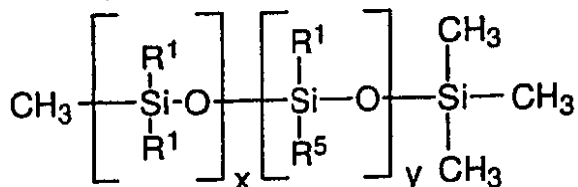
【化 3】



であり、基  $R^1$ 、 $R^2$  又は  $R^3$  の少なくとも 1 つは前記定義によるポリアルキレンオキサイド含有基であることを条件とし、 $n$  は 1 ~ 6 の整数であり、 $x$  及び  $y$  は、ポリシロキサン - ブロックの分子量が 300 ~ 30000 であるような整数であり、 $a$ 、 $b$  は、 $a$  と  $b$  との合計が 0 より大きいことを条件とする 0 ~ 50 の整数であり、 $c$  は 0 又は 1 である ] で表されるものを使用する、前記ポリマーの化粧品処方物のための使用。

【請求項 2】 式 I は次のもの：

【化 4】



を表す、請求項 1 に記載の使用。

【請求項 3】 量比は、

(a) 50 ~ 99.9 質量% 及び

(b) 0.1 ~ 50 質量%

である、請求項 1 に記載の使用。

【請求項 4】 ヘアケア剤としての、請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の使用。